

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 28 年 2 月 25 日 (2016.2.25)

【公表番号】特表 2015-508409 (P2015-508409A)

【公表日】平成 27 年 3 月 19 日 (2015.3.19)

【年通号数】公開・登録公報 2015-018

【出願番号】特願 2014-551607 (P2014-551607)

【国際特許分類】

C 07 C 7/08 (2006.01)

C 10 G 7/08 (2006.01)

C 07 C 11/167 (2006.01)

C 10 G 21/28 (2006.01)

【F I】

C 07 C 7/08

C 10 G 7/08

C 07 C 11/167

C 10 G 21/28

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 1 月 6 日 (2016.1.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

ブタン、ブテン及び 1, 3 - ブタジエンだけではなく、 C_3 炭化水素、 C_4 オリゴマー及びポリマー、並びに $C_5 +$ 炭化水素を含む供給流としての液体粗 C_4 カット (1) から生じる、粗 1, 3 - ブタジエンを得るための選択性溶媒を用いた抽出蒸留用の使用流としての蒸気質精製粗 C_4 カット (2) を製造する方法であって、

前記蒸気質精製粗 C_4 カットは、前記供給流中に存在する前記 $C_5 +$ 炭化水素の三分の二未満と、前記供給流中に存在する前記 C_4 オリゴマー及びポリマーの 5 質量 % 未満とを含み、

前記方法が、

(1) 前記 C_4 オリゴマー及びポリマー、並びに、前記 $C_5 +$ 炭化水素を除去し、それぞれを前記蒸気質精製粗 C_4 カットについて 上記で特定した 残留分量まで減少させる工程と、

(2) 気化容器 (V K) 中で前記液体粗 C_4 カットを蒸発させる工程と、を有し、

その上部領域に前記液体 C_4 カットが供給され、その下部領域で前記気化容器 (V K) との直接ガス及び液体交換の状態にあり、その上部領域から前記蒸気質精製粗 C_4 カット (2) が排出される、1 以上の段を持つストリップング塔 (K) に、前記気化容器 (V K) が付され、

前記ストリップング塔 (K) は、当該塔の頂部のコンデンサーなしに動作する蒸気質精製粗 C_4 カットの製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 9】

前記stripping塔（K）が、1 以上 15 以下の理論段を持つ請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載の蒸気質精製粗 C₄ カットの製造方法。